

【公報種別】 特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】 第 6 部門第 2 区分
【発行日】 令和 6 年 4 月 9 日 (2024.4.9)

【国際公開番号】 WO2023/008532
【出願番号】 特願 2023-538624 (P2023-538624)
【国際特許分類】
G 0 3 F 1/62 (2012.01)
【 F I 】
G 0 3 F 1/62

10

【手続補正書】
【提出日】 令和 6 年 3 月 26 日 (2024.3.26)
【手続補正 1】
【補正対象書類名】 特許請求の範囲
【補正対象項目名】 全文
【補正方法】 変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項 1】

20

窒化ホウ素ナノチューブを有する膜 (BNNT 膜) を含むことを特徴とするペリクル膜。

【請求項 2】
BNNT 膜は、BNNT の束を有するメッシュ、ウェブ又はグリッドを含む請求項 1 記載のペリクル膜。

【請求項 3】
ペリクル膜の厚み全体に占める BNNT 膜の厚みの割合は 90% 以上である請求項 1 又は 2 記載のペリクル膜。

【請求項 4】
13.5 nm の波長を有する光に対して、透過率が 80% 以上である請求項 1 又は 2 記載のペリクル膜。

30

【請求項 5】
13.5 nm 波長を主露光波長として使用する極紫外線 (EUV) 光の露光に用いられる請求項 1 又は 2 記載のペリクル膜。

【請求項 6】
ペリクル膜とペリクルフレームとから構成され、該ペリクル膜が接着剤を介して上記ペリクルフレームの一端面に設けられるフォトリソグラフィ用ペリクルであって、上記ペリクル膜が請求項 1 又は 2 記載のペリクル膜であることを特徴とするペリクル。

【請求項 7】
露光原版に請求項 6 記載のペリクルが装着されていることを特徴とするペリクル付き露光原版。

40

【請求項 8】
露光原版が、EUV 用露光原版である請求項 7 記載のペリクル付き露光原版。

【請求項 9】
請求項 8 記載のペリクル付き露光原版を用いて露光することを特徴とする露光方法。

【請求項 10】
請求項 7 記載のペリクル付き露光原版を用いて、真空下又は減圧下において基板を露光する工程を備えることを特徴とする半導体の製造方法。

【請求項 11】
請求項 7 記載のペリクル付き露光原版を用いて、真空下又は減圧下において基板を露光

50

する工程を備えることを特徴とする液晶表示板の製造方法。

【請求項 1 2】

請求項 7 記載のペリクル付き露光原版を用いて、基板を E U V 露光する工程を備えることを特徴とする半導体の製造方法。

【請求項 1 3】

請求項 7 記載のペリクル付き露光原版を用いて、基板を E U V 露光する工程を備えることを特徴とする液晶表示板の製造方法。

10

20

30

40

50